

高等学校教材



# 模拟电子技术

(第三版)

重庆大学电子学教研组编  
程开明 唐治德 主编

重庆大学出版社

TN710  
84  
2004

# 模 拟 电 子 技 术

## (第三版)

重庆大学电子学教研组 编

程开明 唐治德 主编

重庆大学出版社

## 内 容 简 介

本书按照国家教育部批准的《高等工业学校电子技术基础课程教学基本要求》编写。内容有：半导体器件基础、放大电路基础、集成运算放大器、负反馈放大电路、集成运算放大器的应用、信号发生器、直流稳压电源、模拟电子电路的读图，各章均附有习题。可供 60 ~ 70 学时课堂教学用。

本书可作高等学校电气类、电子类和其他相近专业的教材，也可供有关工程技术人员参考。

## 模拟电子技术

(第三版)

程开明 唐治德 主编

责任编辑：谭 敏 版式设计：谭 敏

责任校对：廖应碧 责任印制：秦 梅

\*

重庆大学出版社出版发行

出版人：张鸽盛

社址：重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学（A 区）内

邮编：400044

电话：(023) 65102378 65105781

传真：(023) 65103686 65105565

网址：<http://www.cqup.com.cn>

邮箱：[fxk@cqup.com.cn](mailto:fxk@cqup.com.cn)（市场营销部）

全国新华书店经销

重庆科情印务有限公司印刷

\*

开本：787 × 1092 1/16 印张：14.75 字数：368 千

1993 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 3 版 2003 年 6 月第 7 次印刷

印数：26 001—30 000

ISBN 7-5624-1063-1/TN · 21 定价：18.00 元

---

本书如有印刷、装订等质量问题，本社负责调换

版权所有 翻印必究

# 第三版序

《模拟电子技术》出版 10 年来受到读者、特别是高等院校师生的青睐，编者和出版社倍受鼓舞，决定再次修订出版。

本次修订保持第二版教材的结构体系，以分立元件及其典型的放大电路为实例介绍电子学的基本理论，全书的重点放在集成电路的原理和应用上。

唐治德主持了本次修订工作，程开明教授提出了修订工作的原则，杨永明等教师付出了艰辛的劳动。

根据读者的反馈意见，调整了书中一些内容的阐述形式。感谢广大读者的关心和支持。

编者

2003 年 5 月

## 第二版序

《模拟电子技术》1993年6月出版以来,受到广大读者,特别是兄弟院校师生的喜爱,到1994年底所印5 000册售完。值此“秋教”征订之机进行再版。

原版体系结构未做变动。结型场效应管、方框图分析法、同相比例运算电路和模拟电子电路的读图等章节做了改写。二极管增加了等效电路,其余部分进行了修订。习题则做了大幅度的调整,符号全部采用国标。对照1993年6月《高等工业学校电子技术基础课程教学基本要求》(修订稿),第二版增加了集成开关稳压电源。

参加第二版工作的有:程开明、唐治德、杨永明、曾孝平、周宝薇和谭金蓉。程开明为主编,负责统编、定稿。唐治德为副主编,协助主编工作。

借此,我们向为原书提出过批评和建议的同志,表示诚挚的谢意!

电子技术的发展日新月异,教学改革任重道远。我们的能力,我们的水平,与时代的要求差距很大,恳请读者对书中的缺点、错误多加指正。

编者

1995年4月

# 初 版 序

根据电气类电子技术基础课程教学需要,我们采用从模拟到数字的体系,编写了讲义。经多年教学实践充实,最后按照1987年国家教委批准的《高等工业学校电子技术基础课程教学基本要求》修订成《模拟电子技术》、《数字电子技术》。本册是模拟电子技术基础部分。

本书以基本概念、基本知识、基本方法为主线,以加强集成削减分立元件为原则编写。作为技术基础课的电子技术,既要学习电子器件、电子电路和主要应用,更重要的是掌握电子线路的基本分析方法。因此,该书注意将基本理论贯穿始终。其次,突出反映现代电子技术的成果——集成电路。分离元件基本放大电路(包括电流源电路、复合组态)压缩为1章,从第3章开始,均以模拟集成电路为核心安排内容。运算放大器、功率放大器、模拟乘法器、集成稳压器的应用得到加强。方法上,既重视定性分析即物理概念上的阐述,又注重数学方法的推理,以简化分析,使之言简意赅。结论尽量以通用形式表达,便于记忆、运用。

除基本内容外,有的章节还有拓宽部分,均以“\*”号标出,可供选用。

本书第1、2章由杨永明、程开明执笔,第3、4、5章由唐治德执笔,第6章由周宝薇、唐治德执笔,第7章由曾孝平执笔,第8章由谭金蓉、杨永明执笔。程开明任主编,负责组织、统编和修改定稿。唐治德、杨永明协助主编工作。编写过程中,郑荣义、赵新权、邓晓琳等同志参加了部分工作,给予了很大支持。

书稿承李时光教授主审,提出了详细的修改意见。对主审及编写出版过程中给予帮助和支持的同志,在此,一并表示诚挚的谢意。

由于我们水平有限,虽然根据各方意见多次修改,书中一定还有不少缺点、错误,恳请读者批评、指正。

编者  
1992年3月于重庆大学

# 目 录

第 1 章 半导体器件基础 .....	1
1.1 半导体基础知识 .....	1
1.1.1 导体、绝缘体和半导体 .....	1
1.1.2 本征半导体 .....	1
1.1.3 杂质半导体 .....	2
1.1.4 PN 结的特性 .....	3
1.2 半导体二极管 .....	4
1.2.1 二极管的结构和特性 .....	4
1.2.2 二极管的主要参数 .....	6
1.2.3 二极管的等效电路 .....	6
1.2.4 特殊二极管 .....	7
1.3 晶体管 .....	9
1.3.1 晶体管的工作原理 .....	9
1.3.2 晶体管的共射特性曲线 .....	12
1.3.3 晶体管的主要参数 .....	13
1.4 场效应管 .....	14
1.4.1 结型场效应管 .....	14
1.4.2 绝缘栅场效应管 .....	17
1.4.3 场效应管的主要参数 .....	21
1.4.4 场效应管的特点和使用注意事项 .....	21
习题 1 .....	22
第 2 章 放大电路基础 .....	27
2.1 放大电路的基本概念 .....	27
2.1.1 放大的概念 .....	27
2.1.2 性能指标 .....	27
2.2 基本放大电路的工作原理 .....	29
2.2.1 放大电路的组成原则 .....	29
2.2.2 静态工作点的设置 .....	29
2.3 放大电路的基本分析方法 .....	31
2.3.1 图解分析法 .....	31
2.3.2 微变等效电路法 .....	35
2.4 工作点稳定电路 .....	38
2.5 单管放大电路的 3 种组态 .....	40
2.5.1 共集放大电路 .....	40
2.5.2 共基放大电路 .....	42
2.6 复合联接放大电路 .....	42
2.6.1 共集-共集放大电路 .....	42

2.6.2 共集-共基放大电路 .....	44
2.7 电流源电路 .....	44
2.8 场效应管放大电路.....	46
2.8.1 场效应管放大电路的静态偏置 .....	46
2.8.2 场效应管放大器的微变等效电路法 .....	47
2.9 多级放大电路 .....	49
2.9.1 多级放大电路的耦合方式 .....	49
2.9.2 多级放大电路的动态分析 .....	52
2.10 单管放大电路的频率响应 .....	53
2.10.1 频率响应的基本概念 .....	53
2.10.2 晶体管混合 $\pi$ 模型和参数 .....	54
2.10.3 单管共射放大电路的频率响应 .....	57
2.10.4 多级放大电路的频率响应 .....	63
习题 2 .....	64
<b>第 3 章 集成运算放大器 .....</b>	<b>70</b>
3.1 差动放大电路 .....	70
3.1.1 射极耦合差动放大电路 .....	70
3.1.2 差动放大电路的输入输出方式 .....	72
3.1.3 差放的改进电路 .....	74
3.2 互补对称功率放大器 .....	77
3.2.1 功率放大器的特点 .....	77
3.2.2 互补对称功率放大器 .....	78
3.3 集成运算放大器 .....	81
3.3.1 集成电路的特点 .....	81
3.3.2 运放电路介绍 .....	81
3.4 运放的主要参数 .....	85
3.5 特殊集成运放 .....	86
3.5.1 运放的分类 .....	86
3.5.2 高输入阻抗集成运放 .....	87
3.5.3 集成功率放大器 .....	88
3.5.4 选择运放的方法 .....	89
习题 3 .....	90
<b>第 4 章 负反馈放大电路 .....</b>	<b>94</b>
4.1 反馈的基本概念 .....	94
4.1.1 反馈及反馈通路 .....	94
4.1.2 反馈的分类 .....	94
4.2 负反馈放大电路的 4 种基本组态 .....	97
4.2.1 电压串联负反馈 .....	97
4.2.2 电压并联负反馈 .....	98
4.2.3 电流串联负反馈 .....	98
4.2.4 电流并联负反馈 .....	99
4.3 负反馈放大电路的方框图分析 .....	100

4.3.1	负反馈放大电路的方框图 .....	100
4.3.2	闭环放大倍数的一般表达式 .....	101
4.3.3	方框图分析法 .....	102
4.4	深度负反馈放大电路的计算 .....	107
4.4.1	深度负反馈电路的特点 .....	107
4.4.2	深度负反馈放大电路分析举例 .....	109
4.5	负反馈对放大电路性能的改善 .....	112
4.5.1	提高放大倍数的稳定性 .....	112
4.5.2	扩展通频带宽 .....	113
4.5.3	减小非线性失真 .....	114
4.5.4	抑制干扰和噪声 .....	115
4.5.5	对输入电阻和输出电阻的影响 .....	115
4.6	负反馈放大电路的自激振荡及消除方法 .....	116
4.6.1	自激振荡的原因及条件 .....	116
4.6.2	用波特图分析电路是否自激 .....	117
4.6.3	相位补偿 .....	119
习题4	.....	122
<b>第5章</b>	<b>集成运算放大器的应用</b> .....	129
5.1	运放的工作状态 .....	129
5.2	基本运算电路 .....	130
5.2.1	比例运算电路 .....	130
5.2.2	加减运算电路 .....	132
5.2.3	积分和微分电路 .....	134
5.3	对数和反对数运算电路 .....	136
5.3.1	对数运算电路 .....	136
5.3.2	反对数运算电路 .....	137
5.4	模拟乘法运算电路 .....	138
5.4.1	对数式乘法运算电路 .....	138
5.4.2	变跨导乘法电路 .....	139
5.4.3	乘法电路的应用 .....	142
5.5	RC有源滤波器 .....	143
5.5.1	滤波器的功能及分类 .....	143
5.5.2	一阶低通滤波器 .....	144
5.5.3	无限增益多环反馈型滤波器 .....	145
5.5.4	压控电压源型滤波器 .....	148
5.6	电压比较器 .....	151
5.6.1	简单电压比较器 .....	151
5.6.2	迟滞比较器 .....	152
5.6.3	窗口比较器 .....	153
习题5	.....	154
<b>第6章</b>	<b>信号发生器</b> .....	163
6.1	正弦波振荡器 .....	163

6.1.1 正弦波振荡原理	163
6.1.2 <i>RC</i> 正弦波振荡器	164
6.1.3 <i>LC</i> 正弦波振荡器	166
6.1.4 石英晶体正弦波振荡器	170
6.2 非正弦波发生器	172
6.2.1 矩形波发生器	172
6.2.2 三角波发生器	173
6.2.3 锯齿波发生器	174
6.2.4 应用举例——多波形信号发生电路	175
习题 6	175
<b>第 7 章 直流稳压电源</b>	<b>183</b>
7.1 单相整流电路	183
7.1.1 单相半波整流电路	183
7.1.2 单相全波整流电路	184
7.1.3 单相桥式整流电路	186
7.1.4 倍压整流	187
7.2 滤波电路	187
7.2.1 电容滤波电路	188
7.2.2 电感滤波电路	190
7.2.3 其他形式的滤波电路	190
7.3 稳压电路	191
7.3.1 硅稳压管稳压电路	191
7.3.2 串联型晶体管稳压电路	193
7.3.3 稳压电路的保护	194
7.4 集成稳压器	195
7.4.1 集成稳压器分类	196
7.4.2 W7800 稳压器	196
7.4.3 三端可调稳压器 W317	199
7.5 开关式稳压电源	204
7.5.1 开关式稳压电源的特点	204
7.5.2 开关式稳压电源的基本工作原理	204
7.5.3 自激式串联型开关稳压电源电路	206
习题 7	207
<b>第 8 章 模拟电子电路的读图</b>	<b>215</b>
8.1 读图的方法及步骤	215
8.2 读图实例	215
8.2.1 YL-1 型音频电疗仪	215
8.2.2 卡拉OK 放大器	217
附录 1 半导体分离器件型号命名方法	221
附录 2 半导体集成电路型号命名方法	223
参考文献	225

# 第1章 半导体器件基础

本章介绍半导体二极管、三极管、场效应管的工作原理，特性曲线和主要参数。

## 1.1 半导体基础知识

### 1.1.1 导体、绝缘体和半导体

容易传导电流的物质叫做导体，如铜、铝、银等金属。几乎不传导电流的物质叫做绝缘体，如塑料、陶瓷、橡皮、玻璃等。导电能力介于导体和绝缘体之间的物质叫做半导体，如硅、锗、硒等。

物质导电性能的根本差异在于物质内部原子间的结合方式以及原子本身的结构。我们知道，原子是由带正电的原子核和带负电的电子组成，而电子又分层围绕原子核不停地运动。图 1.1.1(a)、(b) 分别表示了硅、锗原子的结构模型。原子最外层的电子叫做价电子，有几个价电子就叫做几价元素，物质的导电性与价电子的数目有关。硅和锗都是 4 价元素，为了突出价电子的作用和画图的方便，用图(c)简化模型表示它们，其中 +4 表示原子核及内层电子所具有的电荷。

导体的外层电子受原子核的束缚力很小，在室温下有大量的价电子能够挣脱原子核的束缚成为自由电子（即运载电荷的载流子），在外电场的作用下，作定向运动形成电流。导体的电阻率一般小于  $10^{-3} \Omega \cdot \text{cm}$ 。

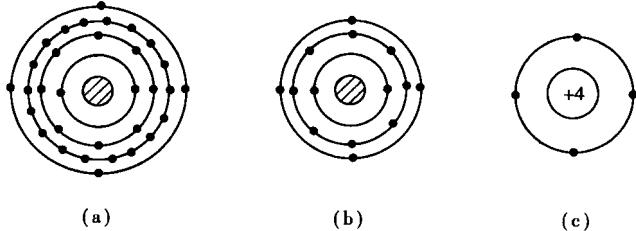


图 1.1.1 硅和锗的原子结构

(a) 锗 (b) 硅 (c) 简化模型

绝缘体的外层电子受原子核的束缚力很大，在室温下不易挣脱出来形成自由电子，故导电性能很差，电阻率一般大于  $10^9 \Omega \cdot \text{cm}$ 。

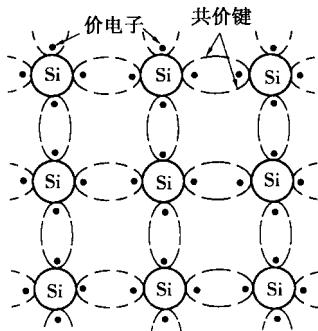
半导体的原子结构比较特殊，价电子既不像导体那样容易挣脱出来，也不像绝缘体那样束缚很紧，因此它的导电性能介于两者之间。

### 1.1.2 本征半导体

完全纯净的、结构完整的半导体叫做本征半导体。

硅、锗制成本征半导体时，其大量的原子排列成很有规律的空间点阵形成晶体。在晶体中，原子之间距离很近，每个原子的 4 个价电子不仅受所属原子核的约束，而且还与相邻的 4 个原子发生联系，即每两个相邻的原子共有一对电子。电子对中任一个电子，一方面围绕自身原子核运动，另一方面也时常出现在相邻原子所属的轨道上，这样的组合叫做共价键结构，如图 1.1.2 所示。共价键中的电子受两个原子核的约束，叫做束缚电子。如果没有足够的能量，

束缚电子不能挣脱共价键的束缚。因此，在绝对温度零度(即0K，相当于-273℃)且无外界



激发时，本征半导体无自由电子，和绝缘体一样不导电。在常温下，由于热运动，将有少数束缚电子获得足够的能量挣脱共价键的束缚成为自由电子——电子载流子。值得注意的是，束缚电子成为自由电子后，在共价键中就留下一个空位，有了这样一个空位，在外电场或其他能源作用下，邻近的束缚电子就会填补到这个空位上，这个电子原来的位置又留下新的空位，其他束缚电子又会递补这个新的空位，如此下去，形成束缚电子的运动。这种运动，等效于一个带正电的空位在移动，叫做空穴运动。由此可知，半导体中不仅有电子载流子，而且还有空穴载流子，这是半导体的一个重要特征。

由于热运动，使本征半导体不断产生自由电子，同时也出现相应数量的空穴。自由电子和空穴总是相伴而生，成对出现，称之为电子-空穴对。另一方面，自由电子在运动中又会与空穴重新结合而消失，这是一种相反的过程，叫做复合。在一定温度下，电子-空穴对既产生又复合，达到相对的动态平衡。这时，产生与复合虽然在进行，但是电子-空穴对却维持一定的数目。载流子的浓度不仅与半导体材料的性质有关，还对温度十分敏感，对于硅材料，温度每升高8℃，载流子的浓度大约增加一倍；对于锗材料，温度每升高12℃，载流子的浓度大约增加一倍。

### 1.1.3 杂质半导体

本征半导体中，载流子的数目有限，导电能力很低。如果掺入微量的杂质，导电性能就会发生显著改变。按掺入杂质的性质不同，分N型半导体和P型半导体。

#### 一、N型\*半导体

在硅(或锗)晶体中掺入少量的5价元素磷P(或砷、锑)，则硅晶体中某些位置的硅原子被磷原子代替，如图1.1.3所示。磷原子有5个价电子，它的4个价电子与相邻硅原子组成共价键后，还多余一个价电子。这个多余的价电子只受自身原子核的束缚，这种束缚力比较弱，只需少量的能量，就能成为自由电子。室温下，几乎所有多余电子都能成为自由电子。

上述杂质半导体，除了杂质给出自由电子外(注意杂质给出自由电子的同时，并不产生新的空穴)，原晶体本身也产生少量的电子-空穴对。这种杂质半导体，自由电子是多数载流子，简称“多子”，空穴是少数载流子，简称“少子”。所以叫做N型半导体或电子半导体。

#### 二、P型\*\*半导体

在硅(或锗)晶体中掺入少量的3价元素硼B(或镓、铟)，如图1.1.4所示。由于硼原子只有3个价电子，与相邻的硅原子组成共价键时，缺少一个电子而形成一个空穴。这样每个杂质原子都会提供一个空穴，从而使空穴载流子的数目大大增加成为多子，自由电子因浓度低而成为少子，这种杂质半导体叫做P型半导体或空穴半导体。

\* N型：N type

\*\* P型：P type

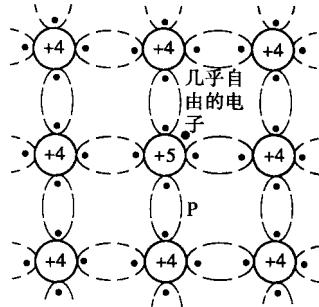


图 1.1.3 N 型半导体结构

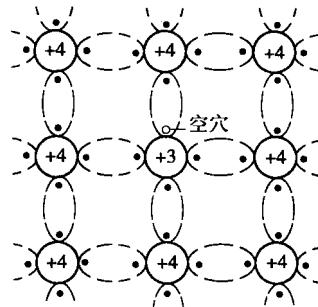


图 1.1.4 P 型半导体结构

#### 1.1.4 PN\* 结的特性

通过掺杂使一块半导体的一边形成 P 型半导体, 另一边形成 N 型半导体, 则在两种半导体的交界面附近, 形成一个具有特殊性质的薄层, 叫做 PN 结, 如图 1.1.5 所示。

##### 一、开路 PN 结

P 型半导体与 N 型半导体结合在一起时, 在交界的地方必然发生, 由于电子与空穴的浓度不均匀分布, 而引起的载流子从浓度高的区域, 向浓度低的区域扩散的现象。扩散到 N 区的空穴与电子复合, 扩散到 P 区的电子与空穴复合, 在交界面附近, 出现了由不能移动的带电粒子组成的空间电荷区。P 型侧为负粒子区(用 $\ominus$ 表示), N 型侧为正粒子区(用 $\oplus$ 表示), 形成了一个由 N 区指向 P 区的电场(内电场)。内电场对多子的扩散不利, 却有利于少子向对方区域运动。载流子在电场作用下的定向运动叫做漂移运动。从 N 区漂移到 P 区的空穴, 填补了 P 区失去的空穴; 从 P 区漂移到 N 区的电子, 填补了 N 区失去的电子, 从而使空间电荷减少, 内电场削弱, 又有利于扩散而不利于漂移。

由此可见, 扩散与漂移既相互联系, 又相互矛盾。扩散使空间电荷区加宽, 内电场增强, 反转来对扩散阻力增大, 使漂移容易进行; 而漂移又使空间电荷区变窄, 内电场削弱, 这又使扩散

容易而阻碍漂移。开始时, 扩散占优势, 随着扩散进行, 空间电荷区加宽, 内电场增强, 于是漂移也不断增强, 当漂移运动与扩散运动达到相等时, 便处于动态平衡状态。此时, 两边虽然仍有载流子的往返, 但扩散多少又漂移多少, PN 结中无电流, 空间电荷不再增加而形成相对稳定状态。

#### 二、PN 结的单向导电性

##### 1. 外加正向电压

PN 结外加正向电压, 即电源的正极接 P 区, 电源的负极接 N 区, 如图 1.1.6 所示, 这种接法叫做正向偏置。

PN 结正向偏置时, 内电场因与外电场相反而受到削弱, 空间电荷减少, 有利于多子的扩散

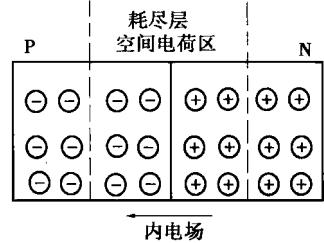


图 1.1.5 无外加电压的 PN 结

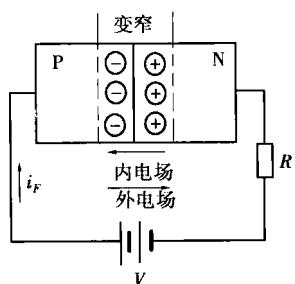


图 1.1.6 PN 结加正向电压

\* PN 结: PN junction

而不利于少子的漂移。多子的扩散通过回路形成正向电流  $i_F$ 。此时,加上不大的正向电压,就可产生相当大的正向电流,为避免烧坏 PN 结,回路中串入电阻  $R$  限流。

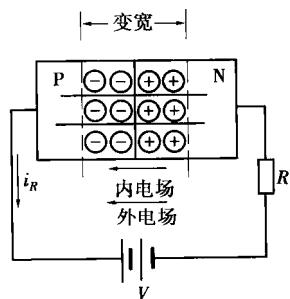


图 1.1.7 PN 结加反向电压

## 2. 外加反向电压

外加反向电压,就是电源的正极接 N 区,电源负极接 P 区,这种接法叫做反向偏置,如图 1.1.7 所示。

PN 结反向偏置时,外电场使空间电荷增加而加强内电场,阻碍扩散而有利于漂移。少子的漂移形成反向电流  $i_R$ 。由于少子数量有限(当温度一定时,少子的浓度不变),因此,反向电流不仅很小,而且在一定范围内基本上不随外加电压变化,故反向电流又叫反向饱和电流  $I_s$ 。

由此可知,PN 结正向偏置时,形成较大的正向电流;PN 结反向偏置时,反向电流很小,这就是 PN 结的单向导电性。

### 三、PN 结结电容

PN 结具有电容效应,按形成原因的不同分势垒电容  $C_b$  和扩散电容  $C_d$ 。

#### 1. 势垒电容 $C_b$

PN 结的空间电荷量随外加电压变化而改变形成的电容效应,叫做势垒电容,记为  $C_b$ 。外加正向电压增加时,P 区的空穴和 N 区的电子扩散到对方区域而中和一部分带电粒子,就像一部分电子和空穴“存入”PN 结,相当于势垒电容充电;外加电压减小时,又有一部分电子和空穴离开 PN 结,好似一部分电子和空穴从 PN 结中“取出”,相当于势垒电容放电。当外加电压不变时,空间电荷量保持不变,势垒电容无充放电现象。因此,势垒电容只在外加电压变化时才起作用,外加电压变化频率越高,其作用越显著。

#### 2. 扩散电容 $C_d$

外加正向电压时,PN 结两侧的载流子扩散到对方区域,并不立即复合消失,而是在一段路程内,一面扩散,一面复合消失。于是,P 区积累(存入)大量的电子,N 区存入大量的空穴。存入电荷的多少随外加电压变化,也是一种电容效应,用扩散电容  $C_d$  来描述。

PN 结的等效电路示于图 1.1.8,其中结电容  $C_j$  为势垒电容与扩散电容之和,即

$$C_j = C_d + C_b$$

正向偏置时,扩散电容较大;反向偏置时,以势垒电容为主。 $C_d$  和  $C_b$  一般为几至几百皮法。

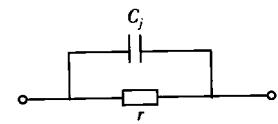


图 1.1.8 PN 结等效电路

## 1.2 半导体二极管

### 1.2.1 二极管的结构和特性

#### 一、二极管的结构

半导体二极管由一个 PN 结加两个引出电极,再用管壳封装而成。P 区引出电极叫阳极(正极),N 区引出电极叫阴极(负极),图 1.2.1 中示出了常见二极管的结构图和符号。

按所用材料来分,有硅二极管和锗二极管。按结构来分,有点接触型、面接触型。点接触

型二极管 PN 结的面积小,不允许通过较大的电流。但它们的结电容小,可以在高频下工作,最高工作频率可达几百兆赫,适用于检波和小功率整流。面接触型二极管 PN 结的面积大,可通过较大的电流,但结电容也大,宜作低频整流用。此外还有一种开关型二极管,在脉冲数字电路中作开关管。

## 二、二极管的特性

二极管的性能常用伏安特性表示,如图 1.2.2 所示,是二极管的端电压  $v$  和流过管子的电流  $i$  之间的关系曲线。可通过实验测得。

### 1. 正向特性

正向电压较小时,正向电流几乎为零,外加电压超过某一数值,才有明显的正向电流,这个数值的电压  $V_{th}$  叫做死区电压,或开启电压,其大小与环境温度及材料有关。硅管  $V_{th}$  约为 0.5 V, 锗管  $V_{th}$  约为 0.1V。当外加电压高于死区电压后,电流随电压基本上按指数规律增长,二极管处于导通状态。当正向电流达到一个较大数值再增加时,其两端电压变化很小,几乎接近一个常数,通常叫做导通电压  $V_{on}$  (或管压降) 硅管  $V_{on} \approx 0.6 \sim 0.8$  V, 锗管  $V_{on} \approx 0.2 \sim 0.3$  V。

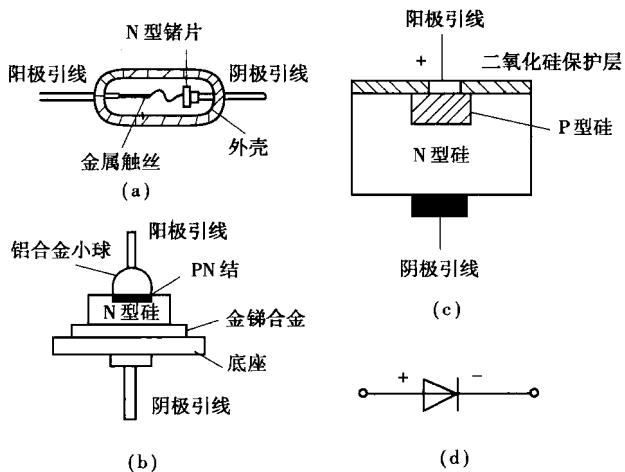


图 1.2.1 二极管结构和符号

(a) 点接触型 (b) 面接触型 (c) 平面型 (d) 符号

二极管反向偏置,反向电流很小,且基本上不随反向电压增加而增大,这个电流叫做反向饱和电流  $I_s$ 。  
3. 反向击穿特性  
当反向电压增加到一定数值(反向击穿电压  $V_B$ )时,反向电流将突然激增,这种现象叫做反向击穿。  
导致二极管击穿的原因有两种:

当半导体材料的掺杂浓度较高时,耗尽层的宽度很窄,在不大的反向电压之下,耗尽层中的电场强度可达到很高的值,将直接破坏耗尽层中原子间的共价键结构,把电子从共价键“拉”出来,形成大量的电子-空穴对,于是反向电流急剧增大,这种击穿叫做“齐纳击穿”。

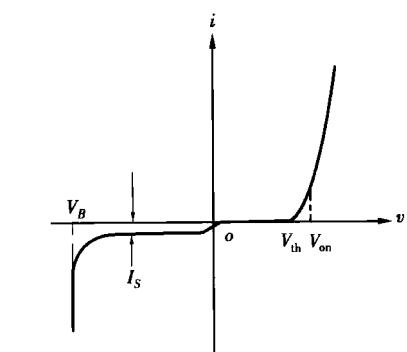


图 1.2.2 二极管的伏安特性

如果耗尽层的宽度比较宽时,当反向电压升高,少数载流子在漂移过程中,受到电场的作用不断被加速,获得足够的动能,当它们与共价键中的电子发生碰撞,将其“撞”出共价键,产生电子-空穴对。这些新的电子和空穴被加速又去撞击其他价电子,发生雪崩式的连锁反应,结果反向电流迅速增大。这种击穿叫做雪崩击穿。

上述两种击穿叫做电击穿。电击穿是可逆的,只要反向电压降低后,仍可恢复原状。但是,当反向电压接近或超过  $V_B$  时,如果没有适当的限流措施,就会因电流大、电压高,使管子过

热造成永性的损坏,这叫做热击穿。电击穿往往为人们利用(如稳压管),而热击穿必须避免。

#### 4. 二极管方程

根据理论分析,通过二极管的电流  $i$  与端电压  $v$  的关系可表示为

$$i = I_s(e^{v/V_T} - 1)$$

式中  $I_s$  为反向饱和电流,  $V_T = KT/q$  为温度的电压当量,  $K$  为玻耳兹曼常数,  $T$  为热力学温度,  $q$  为电子的电量。在常温(300K)时,  $V_T \approx 26\text{mV}$ 。

由此理想二极管方程可知,正向偏置时,只要  $v \gg V_T$ , 则  $i \approx I_s e^{v/V_T}$ , 即电流  $i$  与电压  $v$  基本上成指数关系。反向偏置时,只要  $|v| \gg V_T$ , 则  $i \approx -I_s$  而基本不变。

#### 5. 二极管的温度特性

二级管对温度很敏感。常温下,温度每升高1°C,正向压降减少2~2.5mV;温度每升高10°C,反向电流约增大一倍。

### 1.2.2 二极管的主要参数

二极管的性能除了用伏安特性表示外,还可用一些称为参数的数据来描述。二极管的主要参数如下:

#### 一、最大平均整流电流 $I_F$

它是指二极管长期使用时,允许通过的最大正向平均电流。实际使用时的工作电流应小于  $I_F$ ,如果超过此值,将引起PN结过热而损坏。

#### 二、最高反向工作电压 $V_R$

$V_R$  为二极管两端所允许加的最大反向电压。为安全起见一般取  $V_R = V_B/2$ 。

#### 三、反向电流 $I_R$

在室温条件下,  $I_R$  为管子加上最高反向电压时的反向电流值。其值越小,管子的单向导电性越好。硅管的反向电流一般在几微安以下,而锗管的反向电流较大,为硅管的几十到几百倍。

#### 四、最高工作频率 $f_m$

结电容的存在限制了二极管的工作频率,如果管子所加电压的频率极高,高频电流将直接从结电容通过而破坏PN结的单向导电性。所以,各种型号的二极管都规定有一个最高工作频率  $f_m$ 。

二极管的参数是正确使用二极管的依据。半导体器件手册中给出的不同型号管子的参数,都是在一定条件下测得的。应用时,应注意这些条件,若条件改变,相应的参数值也会发生变化。

### 1.2.3 二极管的等效电路

二极管是非线性元件,为了分析计算方便,在特定条件下近似处理,以线性模型代替。

#### 一、直流模型

二极管具有单向导电性:当外加电压  $v_i \geq V_{on}$ ,二极管导通,管压降为  $V_{on}$ ;外加反向电压,如果忽略很小的反向电流  $I_s$ ,二极管截止。所以,正向电压  $v_i \geq V_{on}$ ,二极管等效为具有  $V_{on}$  值的电源,外加反向电压,反向电流为零,就是二极管的直流模型或开关模型。

如果  $V_{on}$  与串联支路中其他电压相比仍可忽略,即正向偏置时,正向电阻为零,反向偏置

时,反向电流为零,就是所谓理想二极管的模型。

## 二、微变等效模型

二极管导通后,如果在工作点  $Q$ (电压  $V$ 、电流  $I$ )附近,作微小变化时,可用过该点的切线,逼近此小段曲线,如图 1.2.3 所示。此时,二极管的电压变化量和电流变化量成正比,其比值称为二极管的微变等效电阻或交流等效电阻  $r_d = \Delta V / \Delta I$ ,其值可由二极管方程求得

$$\frac{1}{r_d} = \frac{\Delta I}{\Delta V} \approx \frac{di}{dv} = d[I_s(e^{\frac{v}{V_T}} - 1)]/dv = \frac{1}{V_T} I_s e^{\frac{v}{V_T}} \approx \frac{I}{V_T}$$

即

$$r_d = \frac{V_T}{I} = \frac{26 \text{ mV}}{I \text{ mA}}$$

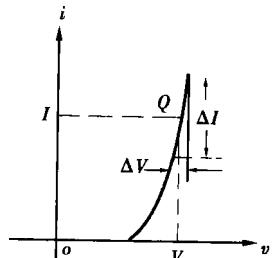


图 1.2.3 由伏安特性求交流电阻

例 1.1 一种简单的检波电路如图 1.2.4 所示。当输入信号  $v_i$  为正负尖脉冲波时,试作出相应的输出  $v_o$  的波形(硅二极管  $V_{on}$  取 0.7V)。

解 首先判断二极管所处的状态。

当  $v_i < 3.7V$  时,二极管截止相当于断开,则  $v_o = 3V$ ;

当  $v_i > 3.7V$ ,二极管导通,相当于一个值为 0.7V 的恒压源,则  $v_o = v_i - 0.7V$ ,所以,输出电压  $v_o$  的波形如图 1.2.4(c) 所示。

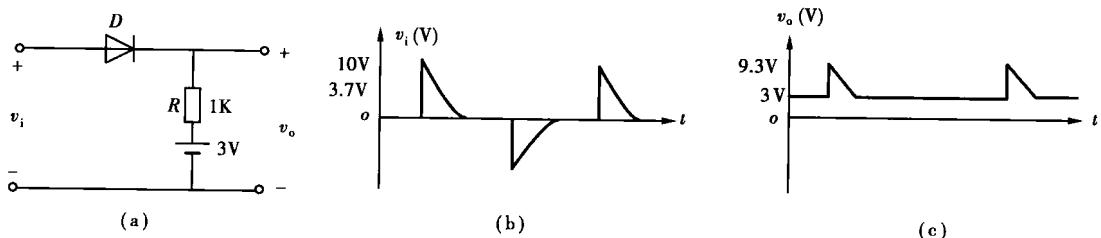


图 1.2.4 检波电路

(a) 电路 (b)  $v_i$  波形 (c)  $v_o$  波形

例 1.2 试分析图 1.2.5 所示电路,当  $V_A$  和  $V_B$  分别为 0V 和 3V 的不同组合时, $V_o$  的值(硅二极管  $V_{on}$  取 0.7V)。

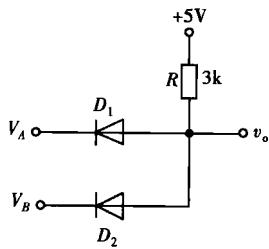


图 1.2.5 二极管门电路  
 $V_o = 0.7V$ 。

解 1. 当  $V_A = V_B = 0V$  时, $D_1$  和  $D_2$  两端的开路电压均超过 0.7V 而导通, $V_o = V_D = 0.7V$ 。

2. 当  $V_A = V_B = 3V$  时, $D_1$  和  $D_2$  两端开路电压仍超过 0.7V 都导通,则  $V_o = V_A + V_D = 3.7V$ 。

3. 当  $V_A = 0V, V_B = 3V$  时,因为  $D_1$  两端的开路电压大于  $D_2$  两端的开路电压,所以  $D_1$  优先导通, $D_1$  导通后, $V_o$  被限制在 0.7V,这就使  $D_2$  处于反向偏置而截止。则  $V_o = 0.7V$ 。

4. 当  $V_A = 3V, V_B = 0V$  时,情况与前类似, $D_2$  导通, $D_1$  截止,

## 1.2.4 特殊二极管

除了上述普通二极管外,还有一些专供特殊用途的二极管。